



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D212326 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 06 月 21 日

(21)申請案號：109306616

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 11 月 26 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-99

(30)優先權：2020/05/27 日本

2020-010384

(71)申請人：日商日立全球先端科技股份有限公司(日本)HITACHI HIGH-TECH CORPORATION
(JP)

日本

(72)設計人：田中一海 TANAKA, KAZUUMI (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D199478

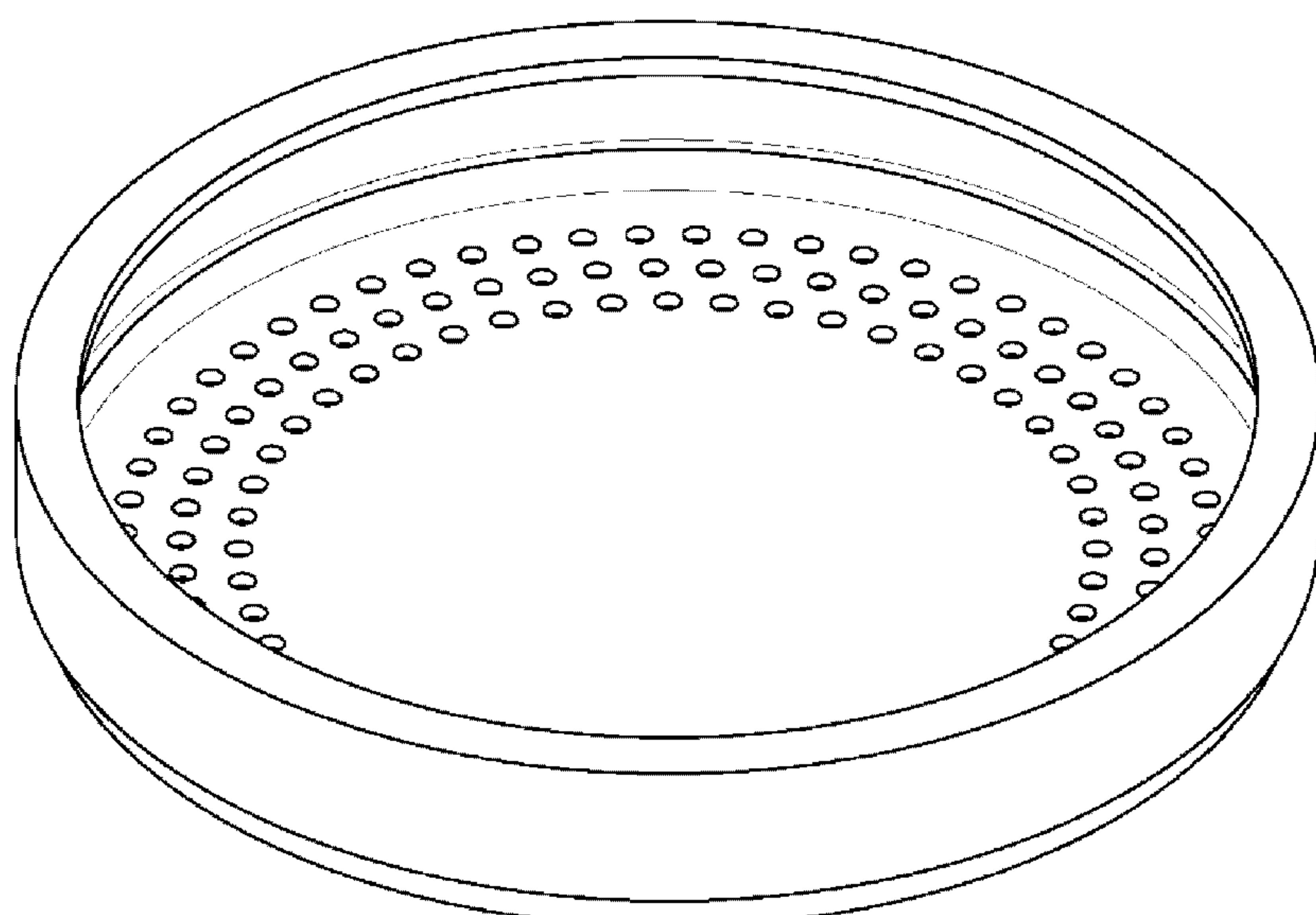
審查人員：朱哲慶

圖式數：10 共 6 頁

(54)名稱

電漿處理裝置用離子遮蔽板

代表圖：



【立體圖】



D212326

【設計說明書】

【中文設計名稱】電漿處理裝置用離子遮蔽板

【物品用途】

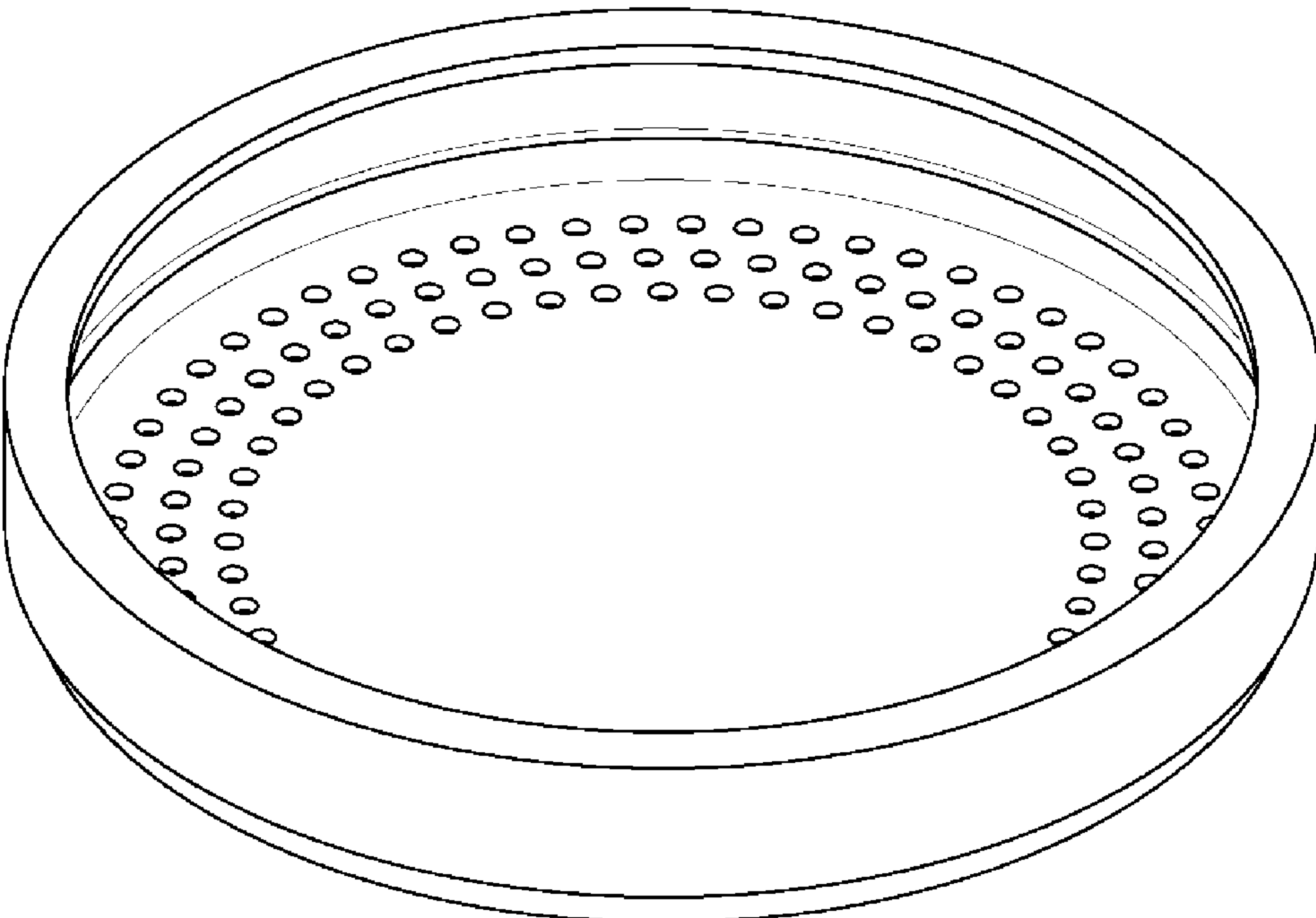
【0001】本設計的物品是電漿處理裝置用離子遮蔽板，為一種應用於在半導體製造裝置所使用的電漿處理裝置，在真空處理室內被設置在氣體之流路中的離子遮蔽板。本物品是用來遮蔽電漿中的離子，只讓自由基(中性活性種)通過。

【設計說明】

【0002】由俯視圖觀之，在外周附近設有許多的小圓形貫通孔，藉此，可讓自由基在外周附近的位置通過。「使用狀態及標示各部名稱之參考圖」是藉由電漿處理裝置的局部示意圖，來表示本物品的設置狀態之例子。晶圓及下部電極等是位於通體本物品之氣體的下方。

【0003】呈現在立體圖中的兩條弧狀細線，皆為用來表現立體表面之形狀的細線。

【設計圖式】
(指定代表圖)

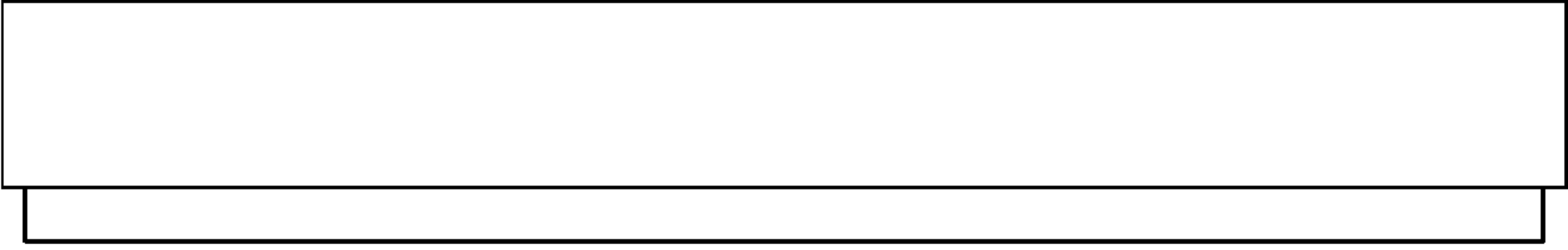


【立體圖】

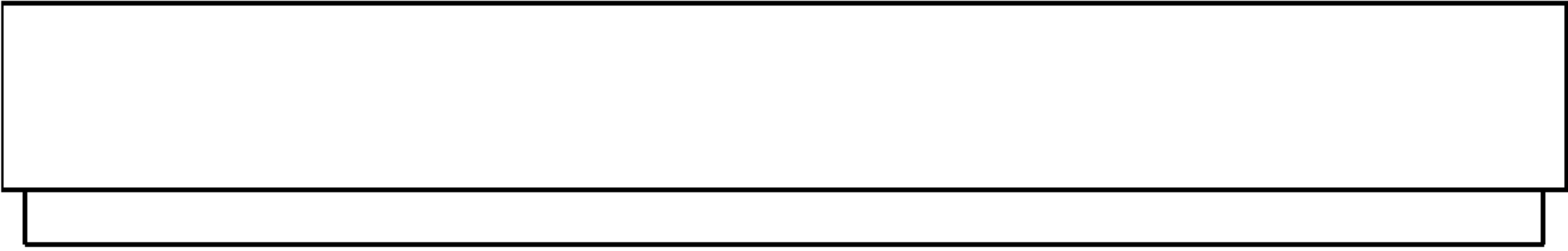
A ←



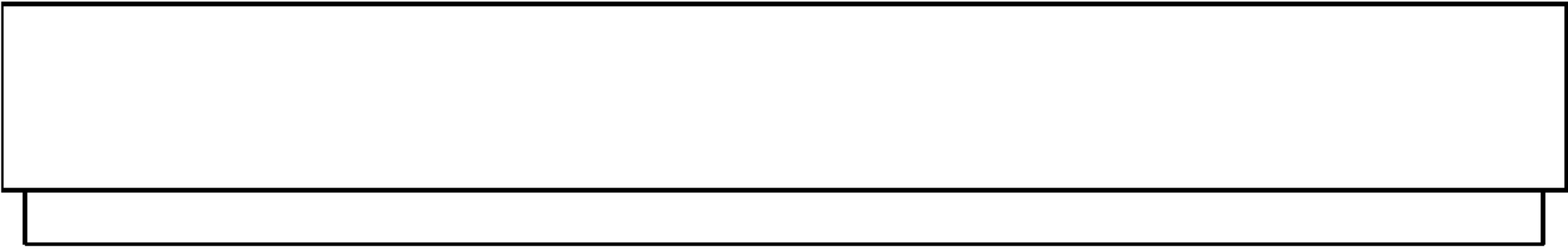
A ←
【前視圖】



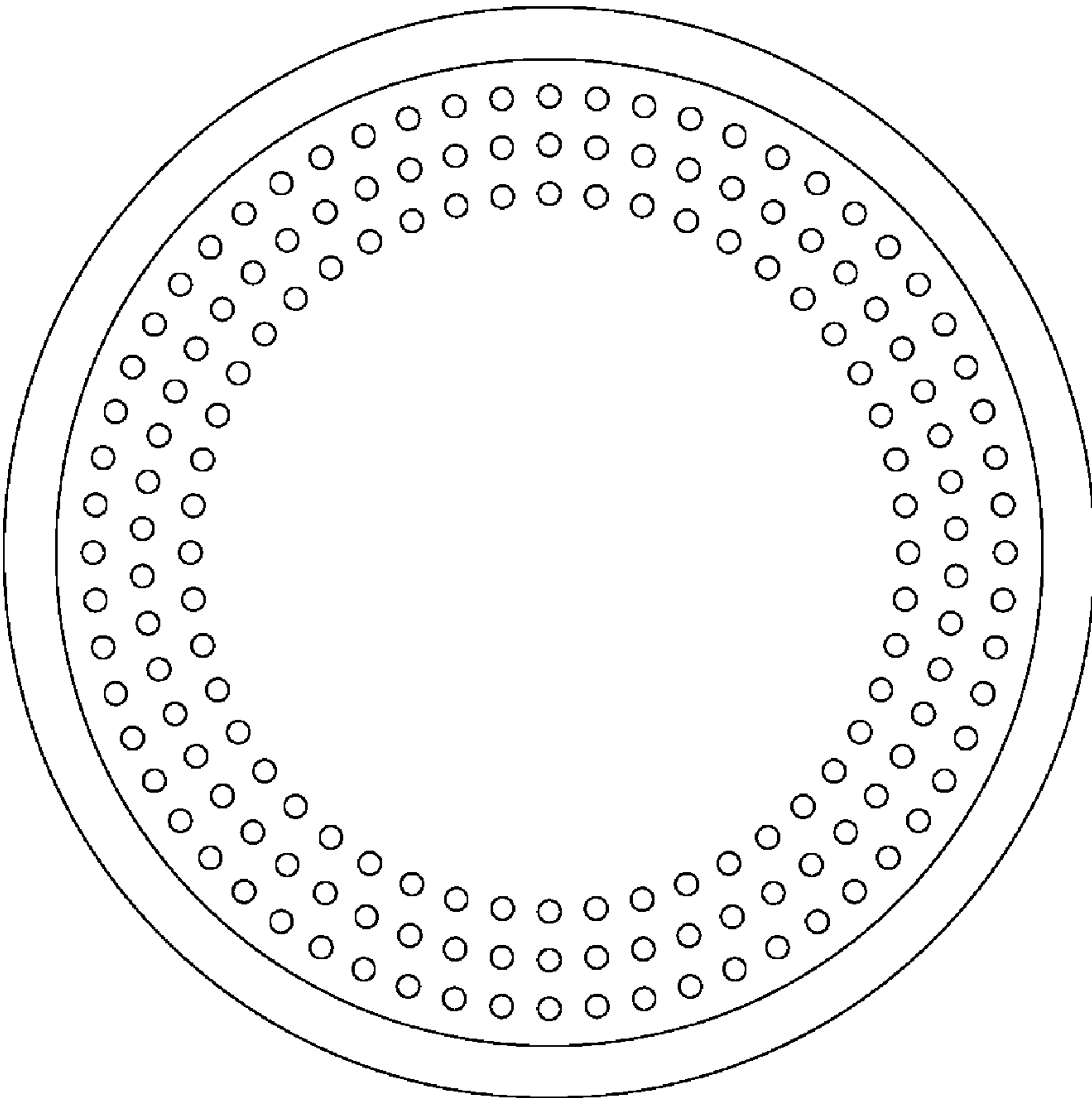
【後視圖】



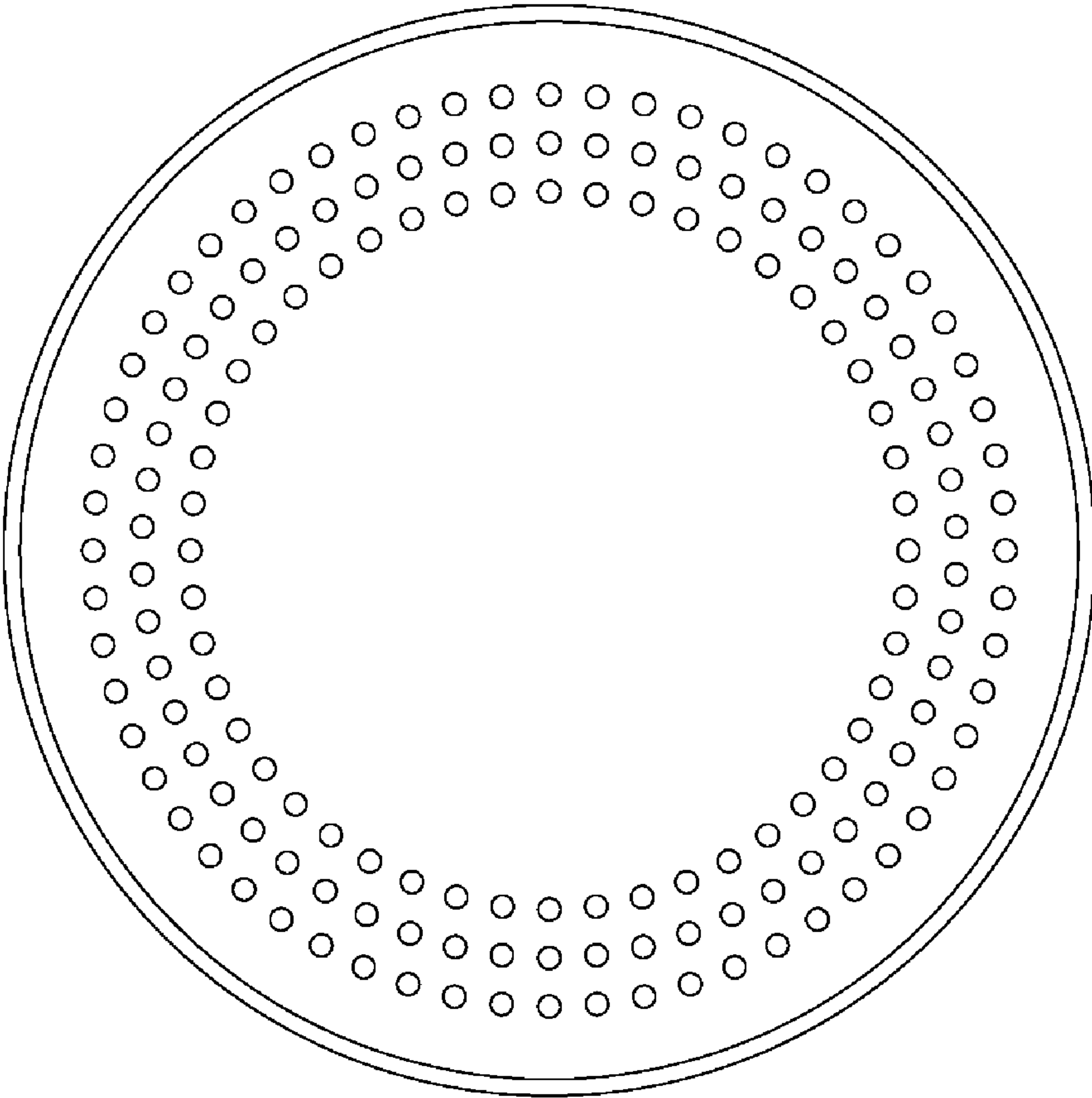
【左側視圖】



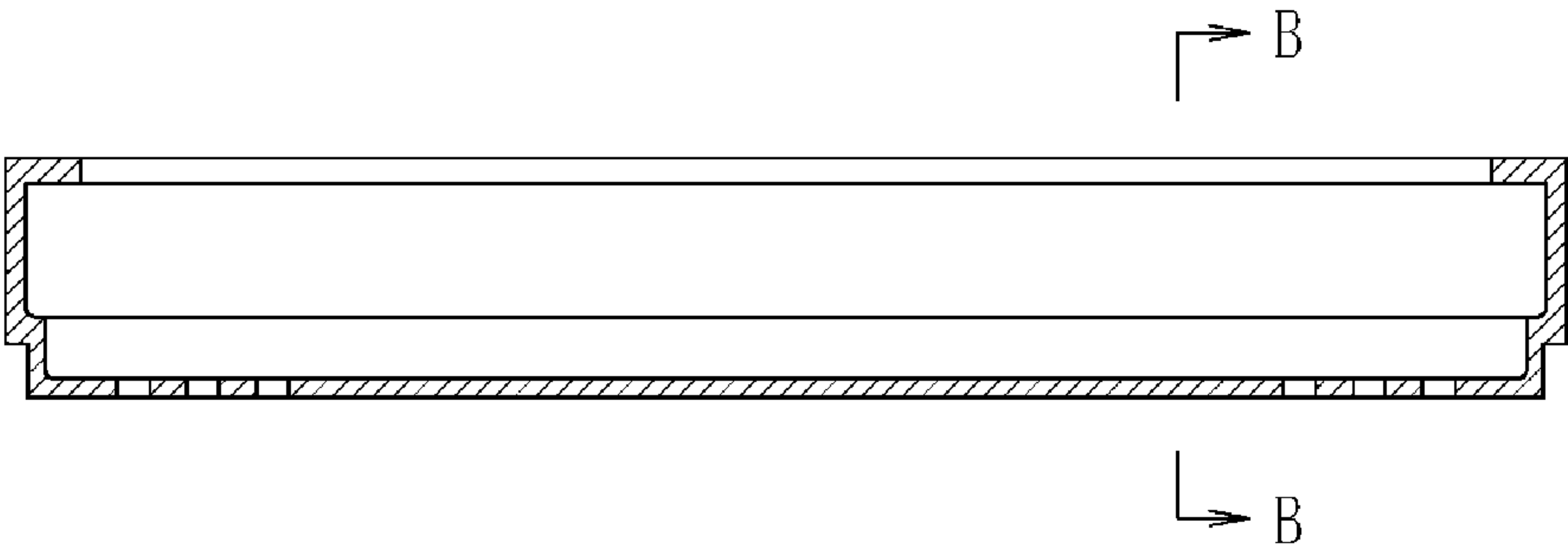
【右側視圖】



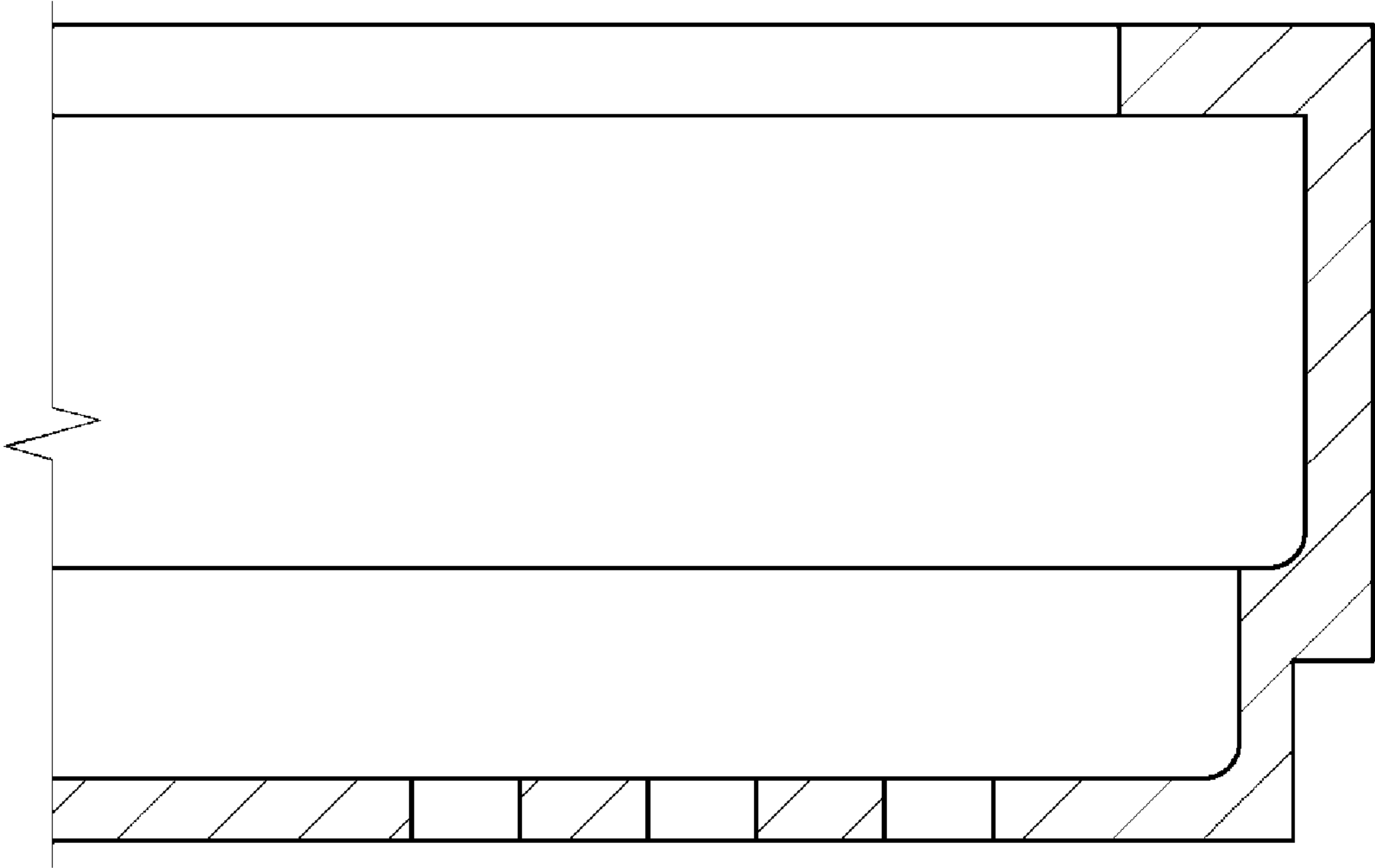
【俯視圖】



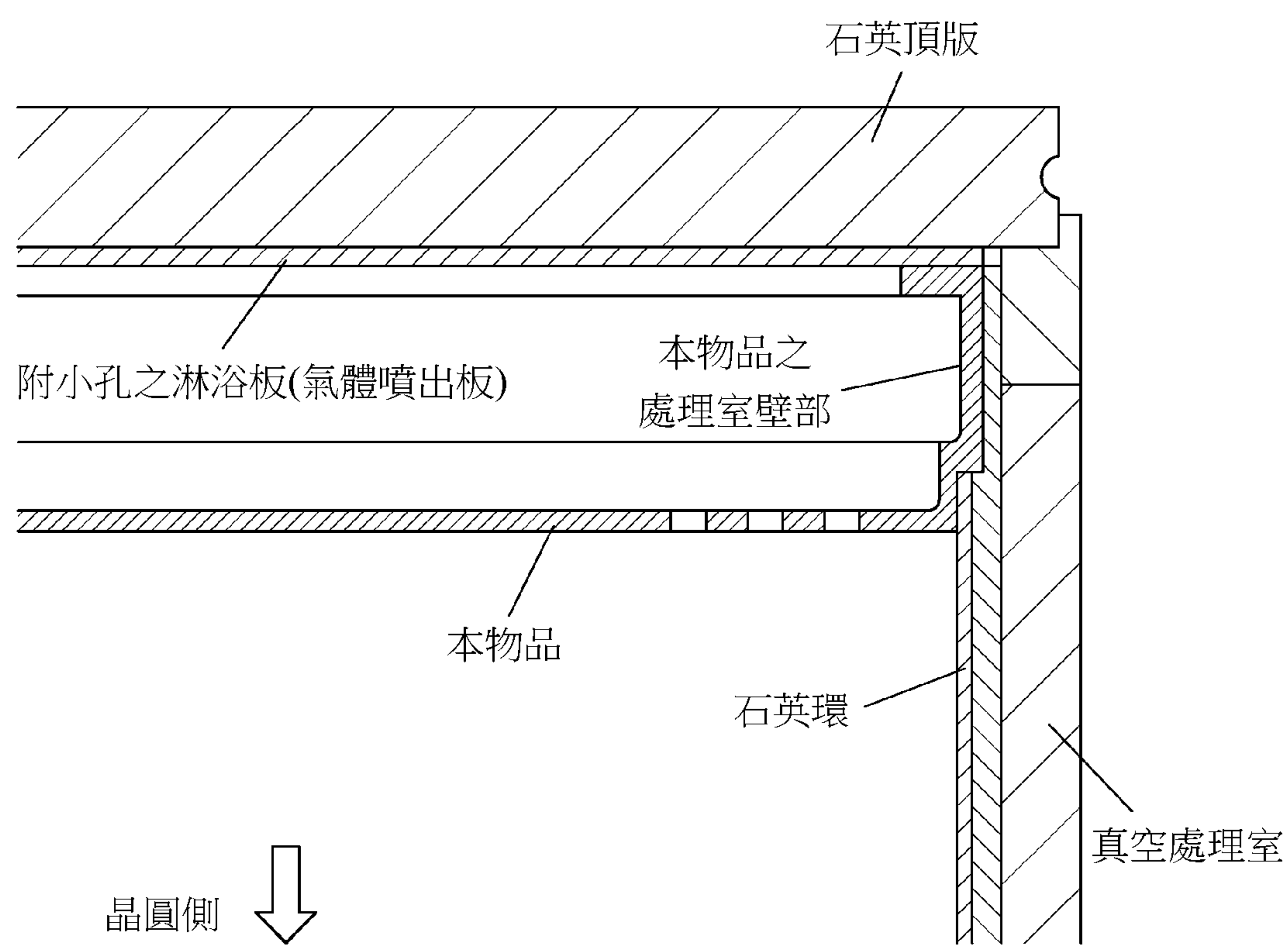
【仰視圖】



【A-A剖面圖】



【B-B部分放大圖】



【使用狀態及標示各部名稱之參考圖】